PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

61-267728

(43) Date of publication of application: 27.11.1986

(51)Int.CI.

G02B 26/10 G01B 11/30 G01N 21/89 // G01B 11/24

(21)Application number : 60-109329

(71)Applicant: HITACHI ELECTRONICS ENG CO

LTD

(22)Date of filing:

23.05.1985

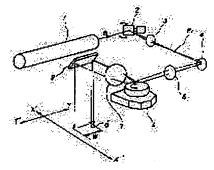
(72)Inventor: HACHIKAKE YASUO

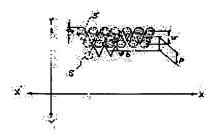
KATO NOBORU ITO MAKOTO UENO YOSHIAKI

(54) LIGHT PROJECTING OPTICAL DEVICE APPROPRIATE FOR HIGH SPEED OPERATION (57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the diameter of a laser spot and to improve the efficiency of a test by moving a laser beam in the X axis direction, reciprocating the laser beam in the Y axis direction.

CONSTITUTION: A laser beam (e) oscillated from a laser oscillator 1 is slightly vibrated by a fine vibration scanner 2. The vibrated beam is passed through a lens 3. intersected with an optical axes at a focus F1, vibrated again, reflected by a mirror 4, and then incident upon a lens 5. The beam passed through the lenses 3, 5 is vibrated in the Y axis direction by the scanner 2. Then, the beam is scanned in the X axis direction by a scanner 6, reflected by a mirror 8 through a scanner lens 7 and converged on a surface to be tested. When a laser spot S' is vibrated in the Y axis direction with amplitude W. almost all the surface to be tested can be scanned even if the scanning pitch size (p) in the Y axis direction is set up larger than ϕ2/2. Consequently, the diameter of the laser spot can be reduced and the testing accuracy can be increased.





特開昭61-267728 (2)

印物群出图公路

⑩日本國特許庁(JP)

特許公報(A) 昭61-267728	行内整理番号 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		PEG0109329	昭60(1985) 5 月23日	神奈川県足柄上部中井町久所300番地 日本電子エンジニアリング株式会社内	神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日本電子エンジニ	アリング株式会社内 神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日本電子エンジニ	アリング株式会社内神経(1870年) 日本日子エンジニ		神奈川県足柄上郡中井町久所300番地			4.1.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	1~135~~2~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	*************************************	- スポットSの笛々, か乾燥 アッチ 上沿っての間	方向 森の韓忠國である。	しめ 被検控団に直交2輪スーズ、, Y ー Y、を設定す	- る。ただし、本発明においてス株をY替と	1915年 1918日	4位 フーザースポットSは吹音。 b. o. dの包	第 へ、X 智力向に危険され、これと共に被称数をは	る Y 包方向にピッチが従って助かされ、被数対回の	な 会局がフーゲースポットのむかパーされる。	上記のようにした複数質面を確れなく数数する	. !
8公開	機別記号 庁 101	高速作動に好透な投光用光学装置	0984 150 4400	09 EN EN THE	母条	母	以	E	1	日立電子エンジニアリ	ング株式会社	士 钛本 正英			光祖光华四四		アーゲービームをスログ	物 E Y 程方向に移動士	さた、位はのフーチーグ	せながらス粒方向に移動	Y作力のの気質にッチム	ポット語の1/1以上に取	くとも大部分を危登し得	とする、英語作品に介護な		
	@Int.CI.* G 02 B 26/10 G 01 B 11/30 G 01 N 21/89 G 01 B 11/24	89発明の名称 高速			8 明备 人	8 明者 加	13 明 38 伊	中 田	1	四	7.4	R 理 人 弁理士	F	匙の始客	斯勒伊斯尼斯斯な数	存録水の範囲	数核效因に数法する	供替しつり、被徴数:	光用光中数四尺的	も7個方向に供償さ	めるように組成し、	V-#-K-40X;	ても被数な回の少な。	うにしたことを存在し	九田光华数据。	
	*	8			8	₩	8	8	;	8		8		æ		\$		ч	Š	4	ذ	æ	ذ	4	我	5

.372—	ř
	ーゲースポットの包を小さくして快点特点を上げ
	4
	(地数の名称)
	「だった」 2 「 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
化四人并进士 架 林 邱 東	ント 2、4 7 全分のに資産すり知恵のよられ、 4をからの必難のシチンが下がある。 4 こうもんき
特 許 出 原 人 B立電子エンジニアリング格式会社	る。本館の図が心思のがなれ心に、フーゲースが
	分は節2段目の危査矢印5、によってカバーされ
	氏点やなしたもら内裂(新数かれた固)の夜四野
*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	てカバーされる区域に低点を付して示してある。
6… 危政困スキャナ、7… スキャンレンズ、8:	第3回は、質問の1図目の危資大印 4、によっ
3…レンズ (A), 4…ミサー、5…レンズ (B	ドガンを扱いなせる。
1…フーが名音略、2…等人登場品メキャナ、	忠控される。被牧型他はピッチ寸法p で V 粒方向
従来数数における技術的困難の説明因である。	向の住役(印ち包数)を与えられつつ、韓方向に
発売の	アーサースボ
3.1 四代本記の日本図を外収式の行政に行うな図ります。 第2回を行政と記れての共和の行政を行政と記れての共和のです。	5大智氏の数両(年1四)によって知道される状态の代数の形を見る
国国の信仰ないの	第2回は、傷◆*のレーザースポット8~
向上とが徹底される。	60の税換 食わめる。
ることとが国立し、後衛結叛の向上と後強闘争の	れ、彼彼道阻に役奴する。固形の寸役がはX輪方
らことと、複数複数の送りアッチを含み大きく-	な、スキャンレンメフを辿ってミラー6で気軽さ
て、地質用スキャナ6によってX粒方向に患強;	上記の目的を遺成するため、本現明の光学報因
によってY仲方向の母勤を与えられている。そ	(名氏の表数)
ズ (B)5 も迅通したピームは収送のスキャナ2	ň
も当遇したパーム荘技大される。 そつたいの フ	る時)に舒適な安治用の光学技能を設立するにあ
ムエクスパンダを導成していて、レンズ (B)5	経過合物 (複数的物のアッチ込りを超過ならつめ
〒記のレンズ(A)3とレンズ (B)5とはビー	形態等間をជ飾して他強縮手を向上せつが称る、
で反射され、レンズ (B)5に入射する。	くして検査結成を上げることができ、しかも検索
纸点でいた光輪と交換し、再び母勢してミサー4	本発用の目的は、フーゲースポットの組化小さ
大られる。この位数はレンズ(A)3を選ぶした。	[数据の目的]
● は数小田敷用スキャナ/2 によって数小田略を	きくすることとが国立しなかった。
フーケー的協協」を心式がフーチーパース外	物の移動ピッチ(皮質ピッチァに超当する)を大
した直交2輪を扱わしている。	さくすることと、検査信仰を上げるために被検索
被被被囚	ドレーキ
称1回江本谷郎の一枚路的や森大的「街いた」	以上のような種由により、従来技術においては
站赴の杖冠堂)	
部分を合うなられらにつかいての動物をある	ることが困難になるとい
の1/2以上に設然しても複数型図の少なくともど	ければならず、スキャナーの反射固が大きくなっ
の母数プッチ 七谷 キフーゲー パームのスポット	はスキャンワンズへの入野パーム笛を大きへしな
X値が向に砂磨むしめるように絡成し、X値が	その上、レーザースポットの値を小さくず
れ、フーゲーバー 4 st Y 性が低に依依されなが	さくずると、危害を受けない区域Vができる。

ここにおいて、彼安信仰を上げようとすると走 質ピッチト省を技大することが准然である。しか

本発明は、数数数国にレーゲー光を投光して表

(発明の利用分野)

発母の評価な数型

堂する殺戮に囚するものである。

(発明の背景)

ため、従来一般に、 $\mathbf{p} < \frac{\phi_1}{2}$ となるようにタ及

びり、が設定される。

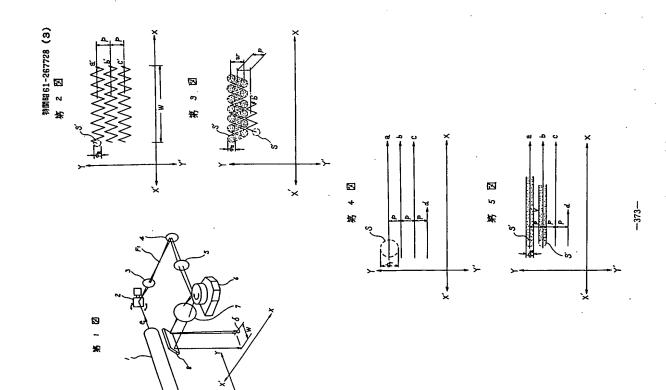
校数位属をよびるために終り回に示すなくワー し、地質ピッチが拉を大きへしてスポット館を大

> しくは沿過光を登出して改装費的の欠略の存款を 被牧権国にフーゲー光を改めて、その反射光台

きくすると彼凶粒度が聞くなる。

ゲースポット 5、の値を,をピッチ寸位のよりも小

-371-



~!V,